

■ 公募情報

公募No.	2025T-86
職種	有期研究技術員
部署	ネットワーク研究所 先端 I C T デバイスラボ
業務名	先端 ICT デバイスラボの設備・装置類の運営サポート業務（本部）
業務内容	先端 I C T デバイスラボ（以下、ラボという）は、埃の非常に少ない状態に維持されたクリーンルーム（プロセス室）を備え、各種の加工プロセスや評価測定のための設備・装置群が配備されています。半導体や誘電体材料を用いたデバイス等の試作により、先端的デバイス研究の推進に寄与しています。クリーンルーム内には半導体結晶成長装置（分子線エピタキシー装置）やドライエッチング装置、蒸着装置、露光装置等が整備されています。業務内容は、複数台あるドライエッチング装置を利用したナノサイズ微細エッチングとその評価および同装置の安定運用のためのメンテナンス業務を中心とし、その他のクリーンルーム内の装置の運用管理および関連した事務的諸手続き等を実施いただきます。ラボの円滑な運営に資する業務をして頂くものです。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格がありません。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	半導体等のドライエッチング装置等のナノサイズの微細エッチング工程およびその評価を実施した経験を有することが望ましい。また、先端 ICT デバイスラボ内には、特に危険を伴う装置を取り扱うため、専門的な知識（高圧ガス製造保安責任者・特別管理産業廃棄物管理責任者・公害防止管理者・有機溶剤作業主任者第 1 種圧力容器取扱作業主任者・特定高圧ガス取扱主任者の各資格及び有害性毒物ガス等をもちいる各種装置の運営業務に携わった経験）があることが望ましい。
募集人員	1 人
本年度契約期間	採用日 ～ 令和8年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与（基本給）	419,000円 ～ 484,000円／月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 （東京都小金井市）
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務） ※時間外労働有

※ 部署名および勤務地名称（業務名、業務内容の記載を含む）に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

※ 従事する業務及び勤務地の変更範囲：原則として変更無し